日刊産業新聞　2007年12月3日（月）

日本精鉱

高純度アンチ増産図る

08年度中に新設備導入

三酸化アンチモンの国内最大手である日本精鉱は、2008年度中に純度99・999％（5ナイン）の高純度金属アンチモンの増産体制を整える。製造拠点の中瀬製錬所（兵庫県）に新しく建屋を造り新設備を導入する。すでに少量生産を開始しているが、今後の需要拡大が期待できる半導体メモリー向けに月数百キログラムの生産体制を整え本格的に販売する。その後は需要動向に応じて段階的に設備を増強する計画。

中瀬製錬所では書換型光ディスクの記録膜形成のターゲット材に使われる、4ナインの高純度金属アンチモンを製造している。生産能力は月2トン体制を整えている。しかし追記型光ディスクとの競合で書換型光ディスク市場が伸び悩み、それに伴って4ナインの金属アンチモンの需要も現在は月1トンの生産にとどまっている。

同社はこのため、さらに純度を高めた5ナインの高純度品を増産し、今後の市場拡大が期待される半導体メモリー向けに販売する。5ナインの製造には新たに開発した技術を組み入れた量産設備を整えた後、08年度中の本格販売をめざす。

光ディスク向けやペルチェ素子向けの4ナイン製品の生産・販売は今後も続ける。半導体メモリー向けとともに販売することで、需要家の要求に応じた製品の品ぞろえを多様化させる。

09年度までの中期経営計画では、新商品の開発による事業基盤の拡充を重点テーマの一つに掲げている。主力製品の三酸化アンチモンは電子・電気機器や自動車に使う樹脂の難燃助剤だが、世界最大のアンチモン生産国である中国との価格競争が厳しい。

07年9月中間期のアンチモン事業が減益だったのは、汎用グレードの三酸化アンチモンの販売が中国の安値放出の影響で低迷したためだ。付加価値の高い新製品を開発することで、三酸化アンチモンに偏った収益基盤を見直す。